



大部分半透明的或具有轻微吸收性的薄膜能够被快速、可靠的测量：
 氧化物、氮化物、感光耐蚀膜、聚合物、半导体(Si, aSi, polySi)、硬涂层(SiC, DLC)，聚合物涂料 (Paralene, PMMA, 聚酰胺)，薄金属薄膜等。

厚度范围: 15 nm-50 μm
 波长范围: 400 nm-1100 nm

LCD, FPD应用: ITO, 细胞间隙, 聚酰胺。光学涂层: 介质滤波器, 硬涂层, 防反射涂层
 半导体和电解质: 氧化物, 氮化物, OLED堆

实时测量和分析。各种多层次的, 薄的, 厚的, 独立和不均匀的层。

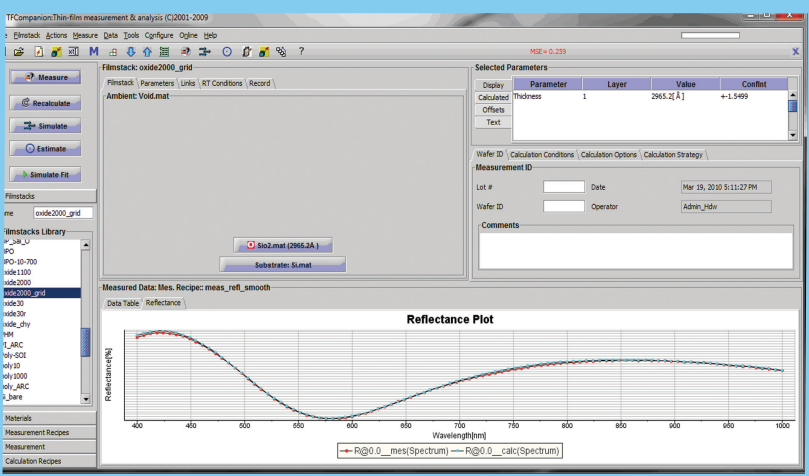
丰富的材料库 (500多种材料) – 新材料容易增添。
 Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz, EMA 等.....

使用灵活: 可联网在操作台桌面或现场进行研究与开发。
 用TCP或Modbus接口能容易的和外部系统连接。

测量参数: 厚度、光学常数、表面粗糙度。

界面友好强大: 测量和分析设置简单。

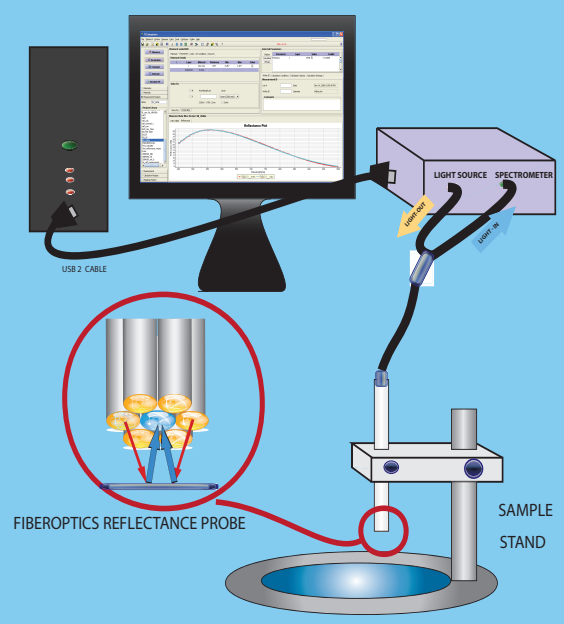
实用的工具: 仿真和灵敏度分析, 背景和缩放修正, 连接层和材料, 多样品测量, 动态测量和生产批量处理。



测量300 nm 硅氧化膜。
 测量与模型数据拟合。

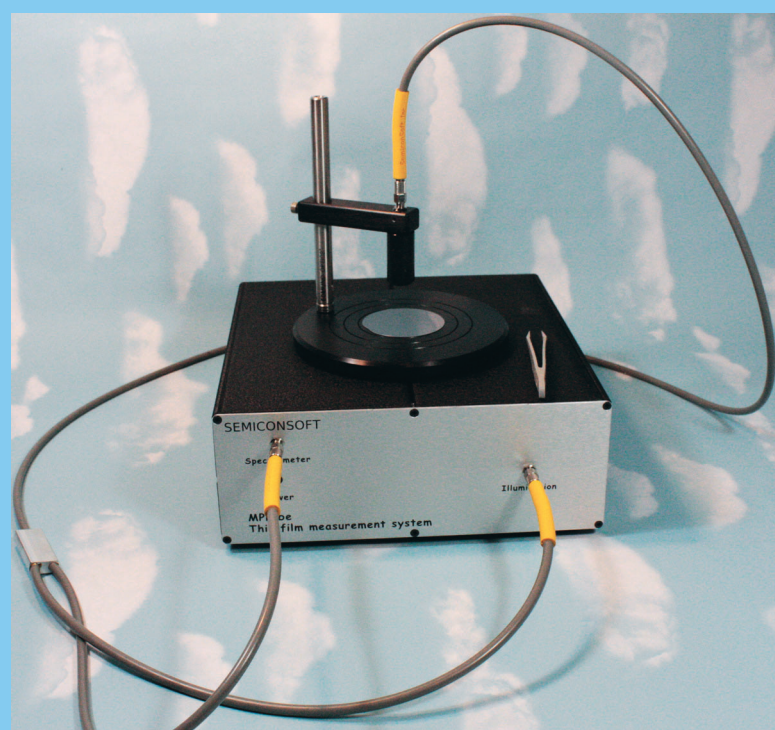
MProbe Vis

Thin Film Measurement System
 It is easy to be an expert with MProbe



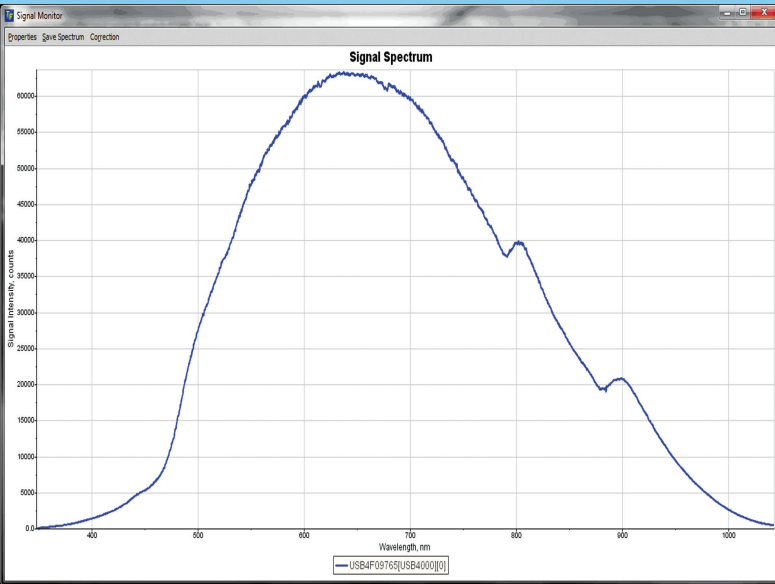
MProbe 系统示意图

精度	0.01nm or 0.01%
精确度	0.2% or 1 nm
稳定性	0.02nm or 0.03%
光斑尺寸	标准为 3mm , 可以小到 3 μm
样本大小	从 1mm 起



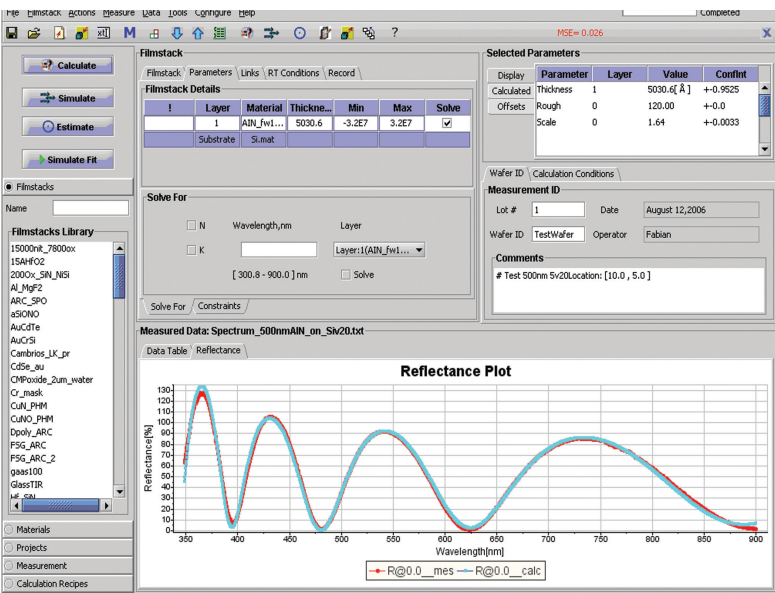
MProbe 系统 (操作台配置)

主要参数



从硅晶片原反射比。信号最大(16位)。
积分时间:10 ms

光谱范围(nm)	400-1100
分光仪/检测器	分光仪F4, Si CCD 3600像素 16位ADC, 距离360-1100 nm
光谱分辨率	<2 nm (标准) <1 nm (选项)
光源	卤钨灯(Xe填充)5 W CT 2800 ° 使用时间:10000 hrs
反射比探测	光导纤维(7纤维束), 400 mm纤维芯
精确	<0.01 nm or 0.01%
精确度	<1nm or 0.2%
重量(主要单位)	4 kg
尺寸(主要单位)	8" x 10" x 4" (WxDxH)
功率	100-250 VAC, 50/60 Hz 20W



测量500 nm AlN。 测量参数:厚度和表面粗糙度。尺寸因子用到正确的距离以改变配置。

硬件选项	
-FLVis	Vis消色差聚焦透镜。WD:35 mm。 光斑尺寸:< 0.5 mm。
-LP500	长通滤波器,限制波长500 nm以下。 用于光阻材料测量。(其他滤波器可用)
-FDHolder	样品架朝下。对于测量透明和柔韧的样本
-TO	透射率选项
-TO Switch	2通道开关,结合测量反射率和透光率。
-20W	更改为20 W(CT 3100 o,使用时间2000 hrs) 卤钨灯。
-HR	升级分光仪分辨率< 1纳米
-TR	在输入/输出触发5V TTL。1外部(输入) 触发器以开始测量,6输出触发器

软件选项

-MOD	基于Modbus标准远程控制(TCP)
-CM	不同测量与指定数量的测量和/或延迟

广州市固润光电科技有限公司

www.guruntech.com

地址:广州市天河区五山路248号金山大厦502室 电话:020-85666701 传真:020-85666701 邮箱:sales@guruntech.com